

結晶加工と評価技術第 145 委員会 第 112 回研究会

日 時 : 2007 年 11 月 19 日 (月) 13:30 - 17:20

場 所 : 弘済会館 4F 蘭の間

テーマ : シリコンフォトニクスと結晶工学・産業界との接点

世話人 : 和田一実 (東京大学大学院)、上浦洋一 (岡山大学大学院)

<プログラム>

13:00-13:10 あいさつ

田島道夫 (宇宙研)

セッション 1: 結晶工学との接点 1 (座長: 豊田紀章)

13:10-13:15 はじめに

和田一実 (東大院)

13:15-13:45 シリコン細線導波路の作製技術

土澤泰、渡辺俊文、山田浩治、福田浩、板橋聖一 (NTTマイクロシステムインテグレーション研究所)

13:45-14:15 Siリング共振器のPL評価

林世云、小林洋介、石川靖彦、和田一実 (東大院)

14:15-14:45 休憩

セッション 2: 結晶工学との接点 2 (座長: 和田一実)

14:45-15:15 Er_2SiO_5 結晶の作製と導波路型発光デバイス応用

一色秀夫、木村忠正 (電通大)

15:15-15:45 ガスクラスタイオンビームによるトリミング加工 (仮題)

豊田紀章、山田公 (兵庫県大)

15:45-16:15 休憩

セッション 3: 産業界との接点 (座長: 森田博文)

16:15-16:45 MIRAIにおけるシリコンフォトニクスの開發現状 (仮題)

大橋啓之 (NEC)

16:45-17:15 パッケージング・実装からみたシリコンフォトニクス

三川 孝 (産総研)

17:15-17:20 終わりに

上浦洋一 (岡山大院)

17:30-19:30 懇親会 菊の間: 会費3,000円 (当日受付にて申し受けます)